

## О ЗАТУХАНИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ В ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЕ

*M. E. Чоговадзе*

Рассмотрена зависимость декремента затухания поверхностной волны в проводящей среде от неоднородности среды (концентрации и частоты столкновений носителей заряда). Показано, что определяемая этими факторами часть декремента затухания в металлах всегда меньше той, которая определяется столкновениями заряженных частиц. Указывается на возможность определения характера неоднородности проводящей среды по затуханию поверхностной волны.

1. Как известно [1], в условиях, когда  $\varepsilon(\omega) \gg 1$ , где  $\varepsilon(\omega)$  — диэлектрическая проницаемость однородной плазмы, т. е. при  $\omega_{Le} \gg \omega$ ;  $v_e$  — в плазме с резкой границей могут распространяться поверхностные электромагнитные волны, частотный спектр и пространственный декремент которых определяется выражениями

$$\omega = k_z c, \quad \operatorname{Im} k_z = \delta_1 = \omega^2 v_e / 2c \omega_{Le}. \quad (1)$$

Здесь  $\omega_{Le} = \sqrt{4\pi^2 n_0 / m_e}$  — ленгмюровская частота электронов с концентрацией  $n_0 = \text{const}$ ;  $m_e$  — масса электрона;  $c$  — скорость света в вакууме;  $v_e$  — частота столкновений электронов. Как было показано в работе [2], при выполнении условия

$$\omega_{Le} (v_0^2/c^2) < v_e < \omega_{Le} (v_0/c), \quad (2)$$

где  $v_0$  — скорость хаотического движения электронов,  $v_0 = v_{Te}$  в случае невырожденной плазмы,  $v_0 = v_{Fe}$ , если плазма носителей вырождена, для поверхностных волн имеется частотная щель, в которой они испытывают дебаевскую экранировку. Ширина частотной щели определяется условием

$$\omega^* = c^2 v_e^3 / v_0^2 \omega_{Le}^2 < \omega < \omega_{Le} (v_0/c) \quad (3)$$

и для некоторых металлов (например, для серебра и золота) может быть довольно значительной [2].

Глубина проникновения в среду поверхностной волны  $\Delta$  зависит от параметров среды

$$\Delta = \frac{c}{\operatorname{Re} \sqrt{k_z^2 c^2 - \omega^2 \varepsilon(\omega)}} \approx \frac{c}{\omega \operatorname{Re} \sqrt{|\varepsilon(\omega)|}} = \begin{cases} c/\omega_{Le}, & \omega \gg v_e, \\ (c/\omega_{Le}) \sqrt{v_e/\omega}, & \omega \ll v_e. \end{cases} \quad (4)$$

Выражения (1), (4) получены в предположении, что плазма однородная, а частота столкновений электронов  $v_e$  постоянная величина. На самом деле частота столкновений изменяется при удалении от поверхности разделя двух сред, т. е.  $v_e = v_e(x)$ . Учет этого обстоятельства естественно приведет к изменению выражения для декремента затухания (1). Кроме того, обычно между различными средами имеется переходной слой, в котором концентрация плазмы неоднородна,  $n=n(x)$ . Поэтому в переходной области всегда найдется точка  $x_0$ , в которой ленгмюровская частота

электропов  $\omega_{Le}(x_0) = \sqrt{4\pi e^2 n(x_0)/m_e}$  оказывается равной частоте поверхности волны в однородной плазме  $\omega \leq \omega_{Le}/\sqrt{2}$ . Из-за этого обстоятельства часть энергии поверхностной волны будет перекачиваться в энергию локализованной объемной ленгмюровской волны — происходит так называемое резонансное поглощение поверхностной волны [3]. В результате к декременту затухания  $\delta_1$  появится поправка, обусловленная таким поглощением.

Представляют интерес определение поправок к декременту затухания  $\delta_1$  поверхностной волны, вызванных непостоянством частоты столкновений электронов  $v_e(x)$  и неоднородностью плазмы  $n(x)$ , и сравнение их между собой и с величиной  $\delta_1$ .

2. В начале рассмотрим случай, когда  $v_e = v_e(x)$ , считая  $n_0 = \text{const}$ , т. е.

$$\epsilon(\omega, x) = 1 - \omega_{Le}^2/\omega [\omega + i v_e(x)]. \quad (5)$$

Плазма занимает полупространство  $x > 0$ , а вакуум  $x < 0$ . Считаем, что

$$E = E(x) e^{-i\omega t + ik_z z}, \quad B = B(x) e^{-i\omega t + ik_z z}.$$

Учитывая, что  $\omega = k_z c$ , а  $|\epsilon| \gg 1$ , из уравнений Максвелла в среде легко получаем уравнение

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{1}{\epsilon(\omega, x)} \frac{\partial}{\partial x} D_x \right] + \frac{\omega^2}{c^2} D_x = 0, \quad (6)$$

где  $D_x = \epsilon(\omega, x) E_x$ . Решение этого уравнения в области вакуума ( $x < 0$ ), где  $\epsilon = 1$ , имеет вид

$$D_{1x} = C_1 e^{\sqrt{k_z^2 - \omega^2/c^2} x}. \quad (7)$$

В плазменной же среде решение уравнения (6) будем искать в виде экспоненты

$$D_{2x} = C_2 e^{\Psi(x)}, \quad (8)$$

где  $\Psi(x)$  — эйконал. Подставляя (8) в преобразованное уравнение (6), для  $\Psi(x)$  получаем

$$\left( \frac{\partial \Psi(x)}{\partial x} \right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(\omega, x) + \frac{\partial^2 \Psi(x)}{\partial x^2} - \frac{\partial [\ln \epsilon(\omega, x)]}{\partial x} \frac{\partial \Psi(x)}{\partial x} = 0. \quad (9)$$

Так как  $|\epsilon| \gg 1$ , решение этого уравнения можно искать в приближении геометрической оптики, разлагая

$$\Psi = \Psi_0 + \Psi_1 + \dots \quad (10)$$

Ограничиваюсь двумя первыми членами разложения  $\Psi$  и учитывая, что в уравнении (9) главными являются два первых слагаемых, окончательно для электрической индукции в среде имеем

$$D_{2x} = C_2 [\epsilon(\omega, x)]^{1/4} \exp \left\{ - \int_0^x \sqrt{-\frac{\omega^2}{c^2} \epsilon(\omega, x)} dx \right\}. \quad (11)$$

Границные условия, получаемые интегрированием уравнения (6) по тонкому переходному слою, имеют вид

$$\{D_x\}_{x=0} = \left\{ \frac{1}{\epsilon(\omega, x)} \frac{\partial}{\partial x} D_x \right\}_{x=0} = 0. \quad (12)$$

Подставляя в этих граничных условиях  $D_{1x}$  и  $D_{2x}$ , определяемые выражениями (7) и (11), находим дисперсионное уравнение для поверхностных волн

$$\epsilon_0 \sqrt{k_z^2 - \frac{\omega^2}{c^2}} + \sqrt{-\frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_0} - \frac{1}{4} \frac{\epsilon'_0}{\epsilon_0} = 0, \quad (13)$$

$$\varepsilon_0 = \varepsilon(\omega, x) |_{x=0}, \quad \varepsilon'_0 = \left[ \frac{\partial \varepsilon(\omega, x)}{\partial x} \right]_{x=0},$$

$\varepsilon(\omega, x)$  определяется формулой (5), причем  $\varepsilon_0 < 0$ .

Уравнение (13) имеет решение, уточняющее (1)

$$\omega \approx k_s c, \quad \operatorname{Im} k_s = \operatorname{Im} \left\{ -\frac{\omega}{2c} \frac{1}{\varepsilon_0} - \frac{1}{4} \frac{\varepsilon'_0}{\varepsilon_0} \sqrt{-\varepsilon_0} \right\}. \quad (14)$$

Подставляя сюда явные выражения для  $\varepsilon_0$  и  $\varepsilon'_0$  из (5), окончательно получим

$$\operatorname{Im} k_s = \delta_1 + \delta_2 = \omega^2 \nu_{s0} / 2c \omega_{Le}^2 + \begin{cases} \frac{1}{4} \frac{\nu'_{s0} \omega^2}{\omega_{Le}^3}, & \omega_{Le} > \omega > \nu_s, \\ \frac{1}{4\sqrt{2}} \frac{\omega^2 \nu'_{s0}}{\omega_{Le}^3} \sqrt{\frac{\nu_{s0}}{\omega}}, & \omega < \omega^* < \nu_s, \end{cases} \quad (15)$$

где

$$\nu'_{s0} = (\partial \nu_s(x) / \partial x)_{x=0}.$$

Таким образом, при  $\nu_s = \text{const}$  поглощение одинаково в области как нормального ( $\omega < \omega^*$ ), так и инерционного ( $\omega_{Le}(\nu_s/c) < \omega < \omega_{Le}/\sqrt{2}$ ) скин-эффекта. Если же  $\nu_s = \nu_s(x)$ , то появляется дополнительное поглощение, различное в этих областях. Заметим также, что экспериментальное измерение поглощения поверхностной волны в среде позволяет с помощью формулы (15) определить производную частоты столкновений.

3. Поправка к декременту затухания (1) возникает и при учете неоднородности плотности плазмы. Для определения этой поправки рассмотрим случай размытой границы между плазмой и вакуумом, когда имеется переходной слой, в котором плотность плазмы неоднородна и в котором найдется точка, где  $\operatorname{Re} \varepsilon(\omega, x_0) = 0$ . В этом случае в формуле (5) считаем  $\omega_{Le}^2 = 4\pi^2 n(x)/m_e$ , а  $\nu_s = \text{const}$ . В точке  $x = x_0$  (при  $\nu_s \ll \omega_{Le}(x_0)$ )  $\omega \approx \omega_{Le}(x_0)$ . Из уравнений Максвелла в среде легко получить следующее уравнение для  $B_y$ :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{1}{\varepsilon(\omega, x)} \frac{\partial B_y}{\partial x} \right] - \left[ \frac{k_s^2 - (\omega^2/c^2) \varepsilon(\omega, x)}{\varepsilon(\omega, x)} \right] B_y = 0. \quad (16)$$

Решения уравнения (16) вдали от границы (в области однородности среды) будем искать в виде поверхностных волн

$$\begin{aligned} B_{1y} &= C_1 e^{-\sqrt{k_s^2 - (\omega^2/c^2)} \varepsilon x} & (x > 0, \text{ плазма}), \\ B_{2y} &= C_2 e^{\sqrt{k_s^2 - (\omega^2/c^2)} \varepsilon x} & (x < 0, \text{ вакуум}). \end{aligned} \quad (17)$$

Эти решения должны удовлетворять граничным условиям, которые получаются из (16) путем интегрирования этого уравнения по переходному пограничному слою

$$\{B_y\}_{x=0} = 0, \quad \left\{ \frac{1}{\varepsilon(\omega, x)} \frac{\partial B_y}{\partial x} \right\}_{x=0} = -i\pi k_s^2 \frac{B_y(x_0)}{|\operatorname{d}\varepsilon(\omega, x)/dx|_{x=x_0}}, \quad (18)$$

где символ  $\{ \}_{x=0}$  означает скачок величины при  $x=0$ .

Подставляя (17) в граничные условия (18), получим дисперсионное уравнение (ср. с [3])

$$\varepsilon_0 \sqrt{k_s^2 - \frac{\omega^2}{c^2}} + \sqrt{k_s^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_0} = i\pi k_s^2 \varepsilon_0 \eta. \quad (19)$$

Здесь  $\eta = |\operatorname{d}\varepsilon(\omega, x)/dx|_{x=x_0}^{-1}$ ,  $\varepsilon_0$  — диэлектрическая проницаемость (5) в области однородности плазменной среды.

Из уравнения (19) находим искомую поправку к декременту затухания (1), вызванного резонансным поглощением поверхностных волн в точке  $x=x_0$

$$\delta_3 = \operatorname{Im} k_z = \frac{\pi\eta |\epsilon_0| \sqrt{k_z^2 - (\omega^2/c^2) \epsilon_0}}{\epsilon_0^2 - 1} k_z. \quad (20)$$

Это поглощение обусловлено резонансной трансформацией поверхностной волны в точке  $x=x_0$  в локальную плазменную волну [3].

Легко видеть, что резонансным затуханием поверхностных волн можно пренебречь по сравнению с затуханием, вызванным столкновениями, если

$$\frac{\delta_3}{\delta_1} = \frac{2\pi\eta |\epsilon_0| \sqrt{k_z^2 - (\omega^2/c^2) \epsilon_0} \omega_{Le}^2}{|\epsilon_0^2 - 1| v_e} < 1. \quad (21)$$

Величину  $\eta$  приближенно можно оценить как  $\eta = |d\epsilon/dx|_{x=x_0}^{-1} \approx x_0/|\epsilon_0|$ . Кроме того, так как в однородной проводящей плазменной среде  $|\epsilon_0| \gg 1$ , то  $\sqrt{k_z^2 - (\omega^2/c^2) \epsilon_0} \approx (\omega/c) \sqrt{|\epsilon_0|}$ , а  $|\epsilon_0| \approx \omega_{Le}^2/\omega^2 \approx \omega_{Le}^2/k_z^2 c^2$ . Тогда неравенство (21) запишется в виде

$$x_0 |k_z^2| < \omega_{Le} v_e / 2\pi c^2. \quad (22)$$

Подставляя значения  $\omega_{Le}$ ,  $v_e$  [4] и допустимые значения волнового вектора  $k_z$  [2], можно убедиться, что в условиях существования частотной щели в спектре поверхностной волны, т. е. при выполнении неравенств (2) неравенство (22) выполняется во всей области существования поверхностных волн, т. е. в области частот, соответствующих нормальному и инерционному скин-эффекту. Это означает, что затухание поверхностных волн в металлах, в которых может существовать частотная щель в спектре этих волн, в основном определяется столкновениями заряженных частиц (электронов) при  $v_e = \text{const}$ , а резонансное затухание является малой поправкой. Малой поправкой является также и та часть затухания поверхностных волн, за которую ответственна неоднородность частоты столкновений. Действительно, если в (14) приближенно считать  $\epsilon'_0 \approx \epsilon_0/x_1$ , где  $x_1$  размер неоднородности частоты столкновений, который в металлах, как правило, порядка нескольких микрон, то из условия малости второго члена в декременте затухания (14) получим (учитывая, что для металлов  $\omega_{Le} \approx 10^{16} \text{ с}^{-1}$ )  $x_1 > c/2\omega_{Le} \approx 10^{-6} \text{ см}$ , т. е. в металлах затухание поверхностных волн в том случае, когда  $v_e = v_e(x)$ ,  $n = \text{const}$ , в основном определяется столкновениями электронов. Притом если  $\delta_2/\delta_3 < 1$ , то поправка декремента затухания (1) определяется резонансным затуханием; если же  $\delta_2/\delta_3 > 1$ , то вкладом резонансного затухания можно пренебречь по сравнению с вкладом в декремент затуханияющей волны, вызванным неоднородностью  $v_e(x)$ .

Используя выражения (15) и (20), а также неравенство (22), получаем, что поправка декремента затухания (1) определяется резонансным затуханием ( $\delta_2/\delta_3 < 1$ ), если выполняется следующее неравенство:

$$v_e' < \begin{cases} 2\omega_{Le} v_e/c, & \omega_{Le} > \omega \gg v_e, \\ 2\sqrt{2} \frac{\omega_{Le} v_e}{c} \sqrt{\frac{\omega}{v_e}} = 2\sqrt{2} \omega_{Le} \sqrt{\frac{v_e |k_z|}{c}}, & \omega < \omega^* < v_e. \end{cases} \quad (23)$$

В заключение хочу выразить признательность А. А. Рухадзе за обсуждение и поддержку работы.

#### Список литературы

- [1] Александров А. Ф., Богданович Л. С., Рухадзе А. А. Основы электродинамики плазмы. М., 1988. 424 с.
- [2] Рухадзе А. А., Чоговадзе М. Е. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 5. С. 1488—1493.
- [3] Кондратенко А. Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме. М., 1985. 207 с.
- [4] Гинабург В. Л., Мотулевич Г. П. // УФН. 1955. Т. 55. С. 469—509.